

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-146020
 (43)Date of publication of application : 06.06.1995

(51)Int.CI.

F25B 9/00
 F25B 9/14

(21)Application number : 05-291869
 (22)Date of filing : 22.11.1993

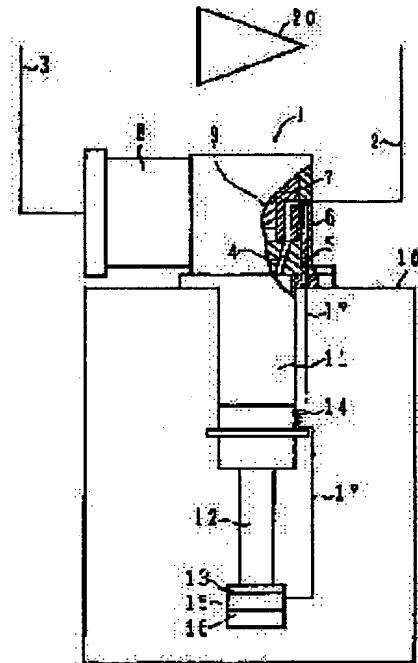
(71)Applicant : SUMITOMO HEAVY IND LTD
 (72)Inventor : RI TAMA
 KANAZAWA KATSUAKI

(54) CRYOGENIC REFRIGERANT

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the need to install a gas supply source outside the device by installing a cold storage means which houses He gas or the like to a cooling part wherein an article to be cooled is held and restraining temperature fluctuations in the cooling unit and connecting the cold storage means to an He gas supply and removal means at the same time.

CONSTITUTION: A compressor 20 discharges He gas from a refrigerator 1 by way of a low pressure side-pipeline 3 and compresses the gas and then introduces the He gas into the refrigerator 1 by way of a high pressure side-pipeline 2. Two stage cold storage units 11 and 12 are installed in a vacuum vessel 10 of the refrigerator 1. A He gas pot 15, which holds a cooled article 16, is mounted to a cooling stage 13 at the tip of the second stage cold storage unit 12. The high pressure side-pipeline 2 and the low pressure side-pipeline 3 are connected to the first cooling unit 11 by way of a valve 7 and a gas flow passage 4. Furthermore, the valve 7 is on/off driven by a motor 8 by way of a shaft 9. A gas flow passage 5, which is connected to the high pressure side-pipeline 2, is formed in a housing 6, which is connected to the He gas pot 7 by way of an He gas introduction small-sized pipe 17.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 11.09.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 2773793

[Date of registration] 24.04.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-146020

(43)公開日 平成7年(1995)6月6日

(51)Int.Cl.⁶

F 25 B 9/00
9/14

識別記号

府内整理番号

D
530 Z

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 5 O.L (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平5-291869

(22)出願日

平成5年(1993)11月22日

(71)出願人 000002107

住友重機械工業株式会社

東京都品川区北品川五丁目9番11号

(72)発明者 李 瑞

神奈川県平塚市夕陽ヶ丘63番30号 住友重
機械工業株式会社平塚研究所内

(72)発明者 金沢 克明

神奈川県平塚市夕陽ヶ丘63番30号 住友重
機械工業株式会社平塚研究所内

(74)代理人 弁理士 高橋 敬四郎 (外1名)

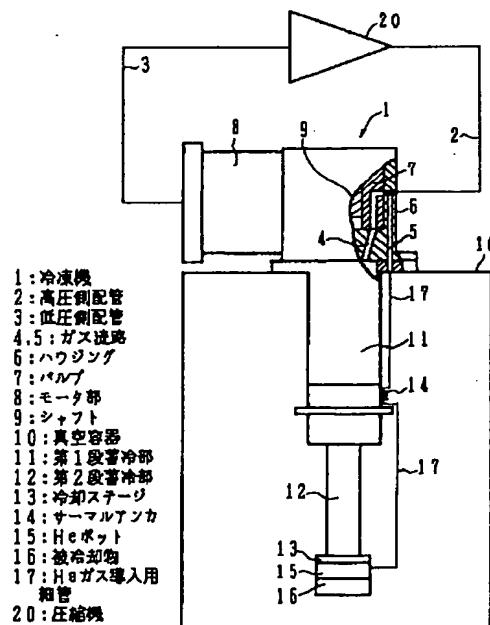
(54)【発明の名称】 極低温冷凍機

(57)【要約】

【目的】 冷却部の温度変化の振幅が小さく、かつ操作方法が簡単で安全性に優れた極低温冷凍機を提供する。

【構成】 ヘリウムガスを膨張させて寒冷を発生させる膨張室と、前記膨張室に圧縮されたヘリウムガスを供給するためのガス供給手段と、前記膨張室からヘリウムガスを排出するためのガス排出手段と、被冷却物を取り付ける冷却部に設けられた、内部にヘリウムガスまたはヘリウムガスと液体ヘリウムを収納する蓄冷手段と、前記ガス供給手段と前記蓄冷手段とを接続するヘリウムガス導入排出手段とを含む。

本発明の第1の実施例



I
【特許請求の範囲】

【請求項1】圧縮ヘリウムガスを生成する圧縮手段と、
ヘリウムガスを膨張させて寒冷を発生させる膨張室と、前記膨張室に圧縮されたヘリウムガスを供給するためのガス供給手段(2)と、前記膨張室からヘリウムガスを排出するためのガス排出手段(3)と、被冷却物を取り付ける冷却部に設けられた、内部にヘリウムガスまたはヘリウムガスと液体ヘリウムを収納する蓄冷手段(15)と、前記ガス供給手段または前記ガス排出手段と前記蓄冷手段とを接続するヘリウムガス導入排出手段(5、17)とを含む極低温冷凍機。
【請求項2】さらに、前記蓄冷手段に収容されたヘリウムガスの温度を測定するための温度測定手段(22)と、前記ヘリウムガス導入排出手段の途中に設けられた減圧弁(24)と、前記温度測定手段の測定結果が入力され、所定の温度に保持されるように前記減圧弁を制御するための制御手段(23)とを含む請求項1記載の極低温冷凍機。
【請求項3】さらに、前記蓄冷手段に収容された液体ヘリウムの液面の高さを測定するための液面位測定手段(25)が設けられており、前記制御手段には、さらに、前記液面位測定手段の測定結果が入力され、液面が所定の高さに保持されるように前記減圧弁を制御する請求項2記載の極低温冷凍機。
【請求項4】真空容器(10)内に配置された膨張室内のヘリウムガスを膨張させて寒冷を発生させる極低温冷凍機において、膨張室に圧縮されたヘリウムガスを供給するためのガス供給手段と、前記膨張室からヘリウムガスを排出するためのガス排出手段と、被冷却物を取り付ける冷却部に設けられた、内部にヘリウムガスまたはヘリウムガスと液体ヘリウムを収納する蓄冷手段と、前記真空容器内に配置された、前記蓄冷手段の容積の少なくとも10倍以上の容積を持ち、内部にヘリウムガスを収容するヘリウムガス収容手段(21)と、前記ヘリウムガス収容手段と前記蓄冷手段とを接続するヘリウムガス導入排出手段とを含む極低温冷凍機。
【請求項5】前記膨張室は、被冷却物を冷却する目標温度と室温との中間の温度まで冷却するための第1の膨張室と、前記目標温度まで冷却するための第2の膨張室とを含み、前記ヘリウムガス導入排出手段には、前記第1の膨張室と熱交換を行うための熱交換手段が設けられている請求項1～4のいずれかに記載の極低温冷凍機。

2
【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、極低温冷凍機に関し、特に温度安定性の高い極低温冷凍機に関する。赤外センサ、S Q U I D 素子または超電導磁石等の冷却において、冷却温度の変動幅が0.1 K以下の安定性が求められる。

【0002】

【従来の技術】従来、極低温において、極めて安定な冷却温度を必要とする場合には、液体ヘリウムを使用するかまたは冷凍機の冷却部に熱浴(寒冷浴)として大きな固体材料ブロックを密着させて、温度の変動振幅を吸収する方法が採られていた。

【0003】しかし、液体ヘリウムを使用する方法では、液体の注入、蒸発または再凝縮等の制御のためのシステム構成や運転操作が複雑になり、コストも高いという欠点がある。

【0004】また、Cu、Al等の固体材料ブロックを冷却部に密着させる方法は、以下のような欠点がある。

20 図8は、Cu、Al、及びHeの温度に対する比熱の変化を示す。横軸は絶対温度を、縦軸は比熱を単位J/cm³・Kで表す。点線b1、b2はそれぞれCu、Alの比熱の変化を示す。図に示すように、Cu、Alの比熱は、温度の低下とともに単調に減少し、温度4 K付近では室温におけるときと比較して1/1000以下に減少する。このため、蓄冷器として使用するためには極めて大きな体積のCuまたはAlを必要とする。

【0005】従って、装置全体の構成も大きくなり、かつ室温からの予冷にも余分なエネルギーと時間が必要となる。さらに、体積が大きくなると、その支持が困難になり、かつ冷却部と被冷却部との熱伝導も悪くなり、冷却部と被冷却部の温度差が大きくなるという問題がある。

【0006】上記問題点を解決して冷凍機の冷却部の温度変化を抑制する方法として、Heガスの熱容量を利用する方法が実開昭62-115060及び特開平3-1053に開示されている。

【0007】図8に示す曲線a1、a2、a3、a4、a5、a6はそれぞれ圧力が1気圧、2気圧、3気圧、5気圧、10気圧、20気圧のときのHeの比熱の温度に対する変化を示す。室温から温度を低下させるとHeの比熱は徐々に増加し、圧力によって若干の相違はあるが、4 K～10 K近傍で極大値を示す。それ以下に温度を低下すると、比熱は緩やかに減少する。

【0008】例えば、温度4 KにおけるHeの比熱は約0.4 J/cm³・Kであり、室温におけるCu、Al等の比熱よりも一桁小さい程度である。従って、4 K付近における蓄冷用材料としては、Cu、Al等の固体材料よりもHeの方が適している。

【0009】

50 【発明が解決しようとする課題】上記の実開昭62-1

15060に開示されている方法は、冷却部に密着して設けたHe ポットに高圧のHe ガスを密閉する方法である。温度の変動を十分に吸収するためには、温度10K以下において数気圧程度のガス圧が必要である。従って、このHe ポットを密閉状態のまま室温に戻すと、ポット内のガスは百気圧を超える圧力になる。このため、冷凍機の運転を停止したときに超高压のHe ガスを装置内に保存することになり安全性に問題がある。

【0010】特開平3-1053に開示されている方法は、He ポットが密閉状態ではなく、冷却時にHe ポットへHe ガスを導入する。従って、冷凍機の運転停止時にHe ガスを放出または回収するので高圧のまま保存する必要はない。He ポットへのHe ガスの導入方法については記載されていないが、一般的にはHe ガスボンベ等から減圧弁を通じて導入されるものと考えられる。この場合、弁の開閉等の操作が必要になる。

【0011】本発明の目的は、冷却部の温度変化の振幅が小さく、かつ操作方法が簡単で安全性に優れた極低温冷凍機を提供することである。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明の極低温冷凍機は、ヘリウムガスを膨張させて寒冷を発生させる膨張室と、前記膨張室に圧縮されたヘリウムガスを供給するためのガス供給手段と、前記膨張室からヘリウムガスを排出するためのガス排出手段と、被冷却物を取り付ける冷却部に設けられた、内部にヘリウムガスまたはヘリウムガスと液体ヘリウムを収納する蓄冷手段と、前記ガス供給手段と前記蓄冷手段とを接続するヘリウムガス導入排出手段とを含む。

【0013】前記ヘリウムガス導入排出手段を介して、前記ガス排出手段と前記蓄冷手段とを接続してもよい。さらに、前記蓄冷手段に収容されたヘリウムガスの温度を測定するための温度測定手段と、前記ヘリウムガス導入排出手段の途中に設けられた減圧弁と、前記温度測定手段の測定結果が入力され、所定の温度に保持されるように前記減圧弁を制御するための制御手段とを含んでもよい。さらに、前記蓄冷手段に収容された液体ヘリウムの液面の高さを測定するための液面位測定手段を設け、前記液面位測定手段の測定結果を前記制御手段に入力し、液面が所定の高さに保持されるようにしてもよい。

【0014】本発明のさらに他の極低温冷凍機は、真空容器内に配置された膨張室内のヘリウムガスを膨張させて寒冷を発生させる極低温冷凍機において、膨張室に圧縮されたヘリウムガスを供給するためのガス供給手段と、前記膨張室からヘリウムガスを排出するためのガス排出手段と、被冷却物を取り付ける冷却部に設けられた、内部にヘリウムガスまたはヘリウムガスと液体ヘリウムを収納する蓄冷手段と、前記真空容器内に配置された、前記蓄冷手段の容積の少なくとも10倍以上の容積を持ち、内部にヘリウムガスを収容するヘリウムガス收

容手段と、前記ヘリウムガス収容手段と前記蓄冷手段とを接続するヘリウムガス導入排出手段とを含む。

【0015】

【作用】被冷却物を取り付ける冷却部にヘリウムガスまたは液体ヘリウムを収容した蓄冷手段を設けることにより、冷却部の温度変動を抑制することができる。

【0016】冷凍機の膨張室にヘリウムを供給し、または膨張室からヘリウムを排出するためのガス供給または排出手段と蓄冷手段とを接続することにより、装置外部にガス供給源を準備する必要がない。また、冷凍機停止時には、蓄冷手段からヘリウムガスが排出されるため、蓄冷手段内が高圧になることを防止できる。

【0017】蓄冷手段にヘリウムガスを導入する配管に減圧弁を設け、蓄冷手段内の温度、または液体ヘリウムの液面の高さが一定になるよう減圧弁を調整することにより、蓄冷手段内のヘリウムの一部を安定性よく液化することができる。液化することにより、熱量の増減が潜熱として使用されるため、冷却部の温度変化をさらに抑制することができる。

【0018】また、蓄冷手段の容積の少なくとも十倍以上の容積を持つヘリウムガス収容手段を蓄冷手段に接続することにより、冷凍機を停止したときに、蓄冷手段内のヘリウムガスをヘリウムガス収容手段に移動させることができる。ヘリウムガス収容手段の容積は蓄冷手段の十倍以上であるため、蓄冷手段及びヘリウムガス収容手段内のガス圧が高圧になることを抑制できる。

【0019】

【実施例】図1～図4を参照して、本発明をギフォードマクマホンサイクルを利用した冷凍機（GM冷凍機）に適用した第1の実施例について説明する。

【0020】図1は、第1の実施例によるGM冷凍機の概略正面図である。なお、説明の都合上ハウジング部については、一部断面を示している。圧縮機20と冷凍機1が高圧側配管2及び低圧側配管3で接続されている。圧縮機20は、低圧側配管3を介して冷凍機1からHe ガスを排気し、圧縮して、高圧側配管2を介して冷凍機1へHe ガスを供給する。

【0021】冷凍機1の真空容器10内には、第1段蓄冷部11及び第2段蓄冷部12が直列に接続されて配置されている。第2段蓄冷部12の先端には冷却ステージ13が設けられている。冷却ステージ13には、He ポット15が密着して設けられている。

【0022】被冷却物16は、He ポット15に密着して保持され、冷却される。高圧側配管2及び低圧側配管3は、バルブ7とハウジング6中に形成されたガス流路4とを介して第1段冷却部11に接続される。バルブ7は、シャフト9によりモータ部8に接続されておりシリンドラの往復運動に同期して第1段冷却部11と高圧側配管2若しくは低圧側配管3との接続切替えが行われる。

【0023】ハウジング6内には、常時、高圧側配管2

に接続されるガス流路5が形成されている。ガス流路5は、Heガス導入用細管17及び第1段蓄冷部11と熱交換を行うためのサーマルアンカ14を介してHeポット15に接続されている。このようにして、高圧側配管2内のガス圧のHeガスが、サーマルアンカ14によって第1段蓄冷部11の温度まで冷却され、Heポット15に供給される。Heガス導入用細管17は、ステンレス等の熱伝導率の悪い材料で構成される。

【0024】Heポット15は、銅等の熱伝導のよい材料で構成される。内容積は用途に応じて数cm³～数百cm³とする。図2(A)に示すように、Heポット内のガスと、冷却ステージとの熱交換の促進を図るために、Heポットの内部にフィン18を設けてもよい。また、フィンの代わりに溝を形成してもよい。

【0025】図2(B)に示すように、Heポット15と冷却ステージ13とを一体化構造にしてよい。一体化構造により、冷却ステージ13とHeポット15との間で熱交換が促進される。一体化構造とせずHeポットと冷却ステージとを接着剤で接着する場合には、熱伝導率の大きい接着剤で取り付けることが好ましい。

【0026】図3は、第1の実施例による極低温冷凍機の冷却ステージ13の温度変化を示す。横軸は時間を単位秒で表し、縦軸は絶対温度を表す。曲線p1はHeポットを使用した場合の温度変化、曲線q1はHeポットを使用しない場合の温度変化を示す。Heポットを使用しない場合には、温度変化の振幅は約0.47Kであるのに対し、Heポットを使用した場合の温度変化の振幅は約0.03Kである。

【0027】図4は、第1の実施例による極低温冷凍機の冷却ステージ13の温度変化の振幅を示す。横軸は冷却ステージの絶対温度を表し、縦軸は冷却ステージの温度変化の振幅を単位Kで表す。曲線p2はHeポットを使用した場合、曲線q2はHeポットを使用しない場合の温度変化の振幅を示す。

【0028】Heポットを使用しない場合の温度変化の振幅は、冷却ステージの温度が2K～16Kの範囲で0.2K以上であり、冷却ステージの温度が約10Kのとき極大値約1Kとなる。Heポットを使用した場合の温度変化の振幅は、冷却ステージの温度が2K～16Kの範囲で0.15K以下であり、特に冷却ステージの温度が4K近傍では0.1K以下である。

【0029】このように、Heポットを使用することにより、冷却ステージの温度変化を抑制することができる。第1の実施例による極低温冷凍機は、従来の極低温冷凍機にHeガス導入用細管17とHeポット15を追加しただけの簡単な構成であり、低コストで実現できる。さらに、調整弁等の操作を必要とする部分がないため、従来の極低温冷凍機と同様の操作で運転することができる。

【0030】極低温冷凍機を停止すると、冷却ステージ13が徐々に室温に戻る際に、Heポット15から高圧側配管2にガスが戻される。このため、Heポットに数百気圧といった高い圧力が印加されることなく、特別な圧力管理の必要もない。

【0031】Heポット15内の容積は、圧縮機20のガス容積の数百ないし数千の一しかない。そのため、Heポットが冷却されて内部のガス圧が低下し、圧縮機内のガスがHeポット内に導入されて、Heポット内のガス量が数十倍に増加したとしても圧縮機や冷凍機に対する影響はほとんどない。

【0032】図5は、本発明の第2の実施例による極低温冷凍機を示す。Heガス導入用細管17は、ハウジング6に形成されたガス流路5aを介して第1段蓄冷部11からガスを排気するための低圧側ガス流路26に接続されている。低圧側ガス流路26は、フランジ19に設けられたガス流路を介して低圧側配管3に接続されている。その他の構成は、図1の第1の実施例と同様である。このように、第1の実施例では、Heガス導入用細管17は高圧側配管2に接続されていたが、第2の実施例では低圧側配管3に接続されている。

【0033】図8に示すように、温度4K近傍でのHeの比熱は、圧力依存性が少ないため、第2の実施例に示すように低圧側配管からHeポットにガスを導入しても第1の実施例と同様の効果が期待できる。

【0034】図6は、本発明の第3の実施例を示す。真空容器10内の高温側に高温バッファ21が設けられている。高温バッファ21とHeポット15はHeガス導入用細管17及びサーマルアンカ14を介して接続され、気密空間とされている。その他の構成は、図1の第1の実施例と同様である。

【0035】Heポット15が冷却されると、内部のガス圧が低下し高温バッファ21からHeガスが導入される。極低温冷凍機が停止しHeポット15が室温に戻されると、Heポット15内のHeガスは高温バッファ21に戻される。高温バッファ21の容積がHeポット15の容積の10倍以上、好ましくは数十倍であれば、冷凍機停止時の保存圧力を十数気圧以下にすることが可能である。従って、極低温冷凍機を停止した場合でも、Heポットに高圧力が加わることがない。

【0036】図7は、本発明の第4の実施例を示す。Heポット15には、高圧側配管2からバルブ24を介して分岐したHeガス導入用細管17及びサーマルアンカ14を介してHeガスが導入される。Heポット15には、温度計22が設置されており、測定結果が制御装置23に入力される。制御装置23は、Heポット15内の温度が所定の温度になるようにバルブ24を制御する。

【0037】その他の構成は、図1の第1の実施例と同様である。Heポット15の容積は一定であるため、内

部のHeガスの温度を測定すれば圧力を求めることができる。従って、バルブ24を調整することにより、Heポット15内の圧力を所定値に保つことができる。

【0038】Heは、2.5気圧以上になると、超臨界になり温度を下げても液化しなくなる。バルブ24を調整してHeポット15内の圧力が2.5気圧以下になるように制御することにより、Heポット15内のHeを液化させることができる。Heポット15内のHeの一部が液化すれば、熱量の変化は潜熱として使用され温度変化として現れないため、さらに温度の安定性を高めることができる。

【0039】さらに、Heポット15内のHeの液化量を測定するための液面位計25を設置してもよい。液面位計は、例えば液体He温度で超伝導状態になる金属を使用した超伝導線をHeポット15内に垂直に配置して構成できる。液体Heに浸漬した部分は超伝導状態になるため電気抵抗は0になり、液面から上部の部分は常伝導状態の電気抵抗を示す。従って、その電気抵抗を測定することにより液面の高さを求めることができる。

【0040】液面位計25の出力は制御装置23に入力される。制御装置23は、Heポット15内の温度、及び液面の高さが所定値になるようにバルブ24を制御する。Heポット15内のHeの液化が始まると、その後温度は殆ど変化しなくなり、温度を基準とした制御が困難になる。しかし、上記のように、Heポット15内のHeの液化量が一定になるように制御することにより、安定してHeポット15内の温度を制御することができる。

【0041】上記実施例では、GM冷凍機に適用する場合について説明したが、動作ガスとしてヘリウムを使用する冷凍機であればその他の冷凍機にも適用可能である。例えば、スターリング冷凍機等にも適用可能である。

【0042】以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。

【0043】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、装置構成及び運転操作を複雑にすることなく、極低温冷凍機の温度変動を抑制することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例による極低温冷凍機の一

部断面を含む正面図である。

【図2】本発明の第1の実施例による極低温冷凍機のヘリウムポットの断面図である。

【図3】本発明の第1の実施例による極低温冷凍機を使用した場合の冷却部の温度変化を示すグラフである。

【図4】本発明の第1の実施例による極低温冷凍機を使用した場合の冷却部の温度に対する温度変化の振幅を示すグラフである。

【図5】本発明の第2の実施例による極低温冷凍機の一部断面を含む正面図である。

【図6】本発明の第3の実施例による極低温冷凍機の正面図である。

【図7】本発明の第4の実施例による極低温冷凍機の正面図である。

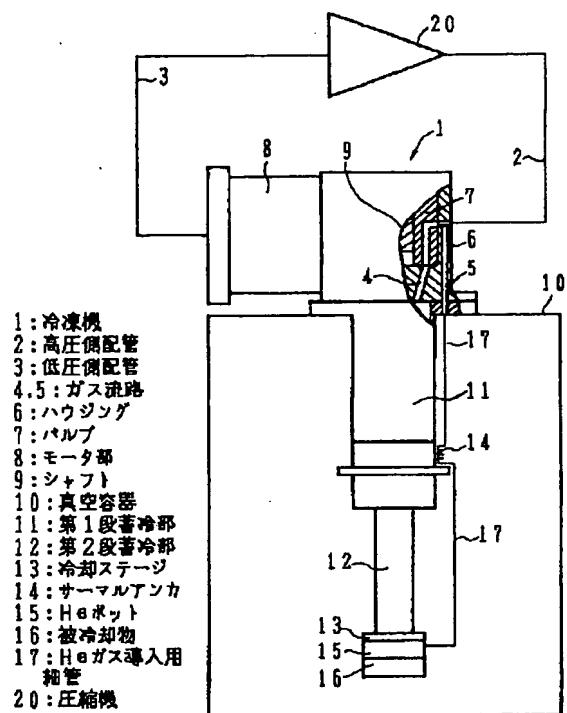
【図8】Cu、Al、Heの温度に対する比熱の変化を示すグラフである。

【符号の説明】

- | | |
|--------|-----------|
| 1 | 冷凍機 |
| 2 | 高圧側配管 |
| 3 | 低圧側配管 |
| 4、5、5a | ガス流路 |
| 6 | ハウジング |
| 7 | バルブ |
| 8 | モータ部 |
| 9 | シャフト |
| 10 | 真空容器 |
| 11 | 第1段蓄冷部 |
| 12 | 第2段蓄冷部 |
| 13 | 冷却シテージ |
| 14 | サーマルアンカ |
| 15 | Heポット |
| 16 | 被冷却物 |
| 17 | Heガス導入用細管 |
| 18 | フィン |
| 19 | フランジ |
| 20 | 圧縮機 |
| 21 | 高温バッファ |
| 22 | 温度計 |
| 23 | 制御装置 |
| 24 | 減圧弁 |
| 25 | 液面位計 |
| 26 | 低圧側ガス流路 |

【図1】

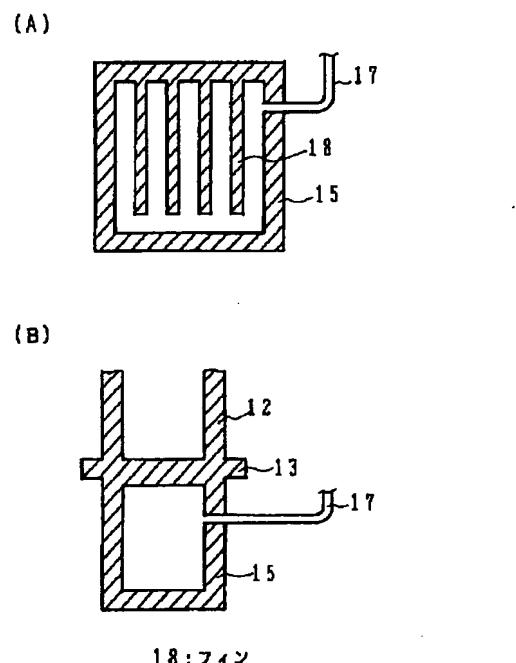
本発明の第1の実施例



- 1:冷凍機
- 2:高圧側配管
- 3:低圧側配管
- 4.5:ガス路
- 6:ハウジング
- 7:バルブ
- 8:モータ部
- 9:シャフト
- 10:真空容器
- 11:第1段蓄冷部
- 12:第2段蓄冷部
- 13:冷却ステージ
- 14:サーマルアンカ
- 15:Heポート
- 16:被冷却物
- 17:Heガス導入用
細管
- 20:圧縮機

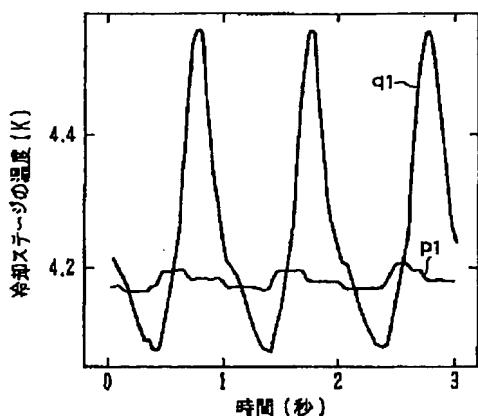
【図2】

Heポート



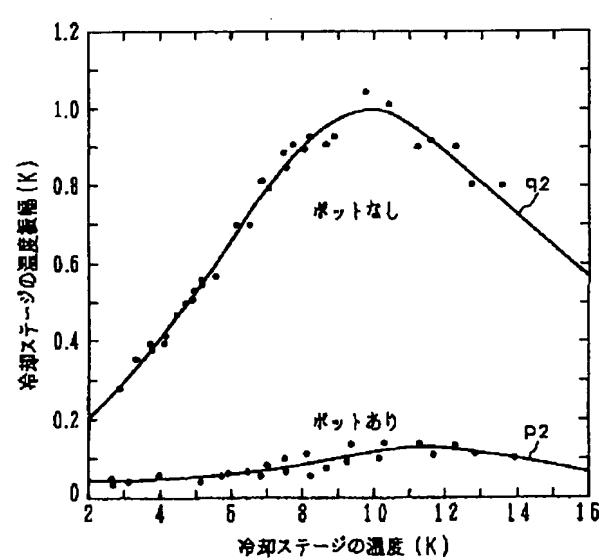
【図3】

第1の実施例における温度変化



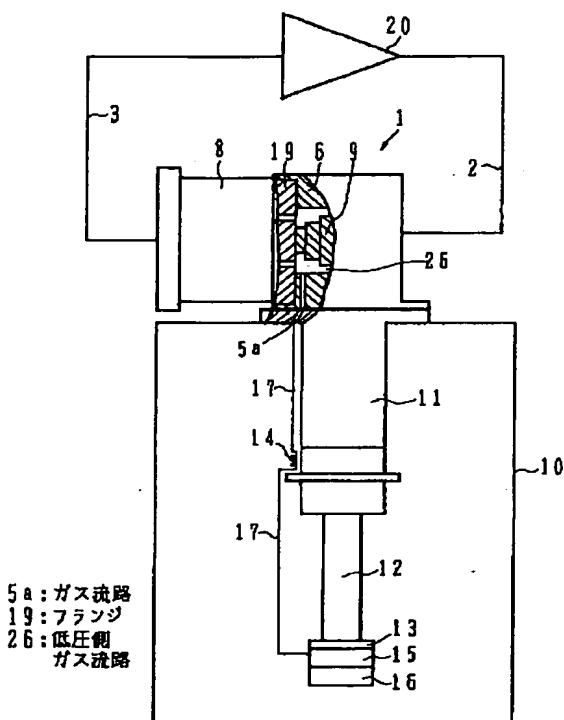
【図4】

第1の実施例における冷却ステージの温度振幅



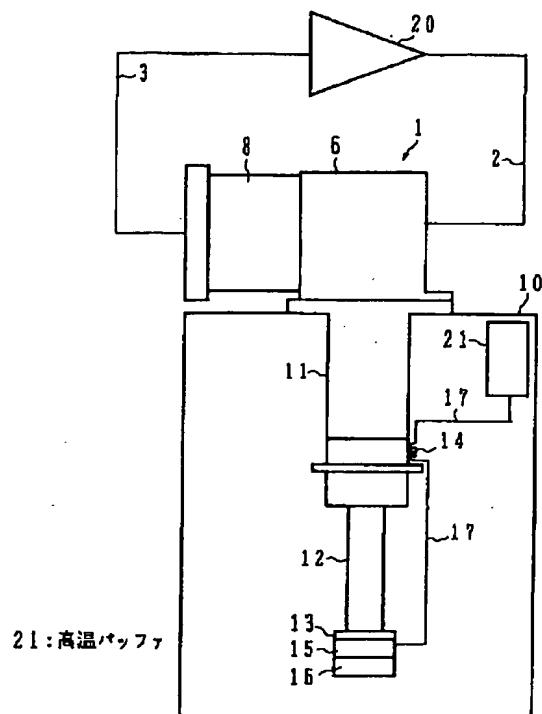
【図5】

本発明の第2の実施例



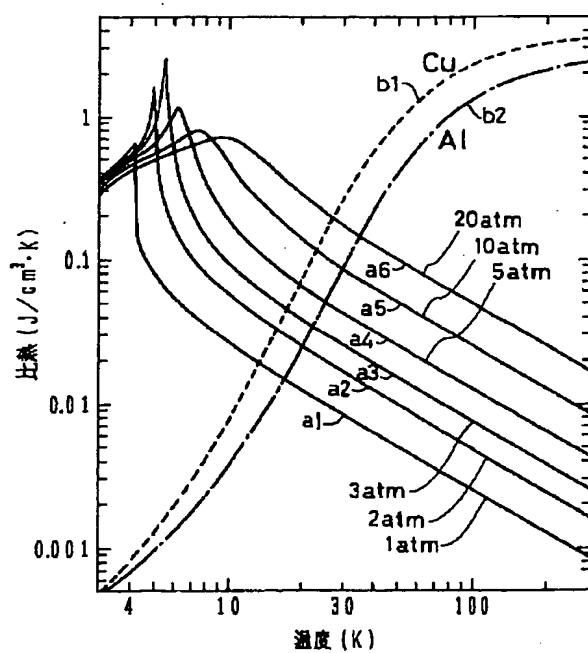
【図6】

本発明の第3の実施例



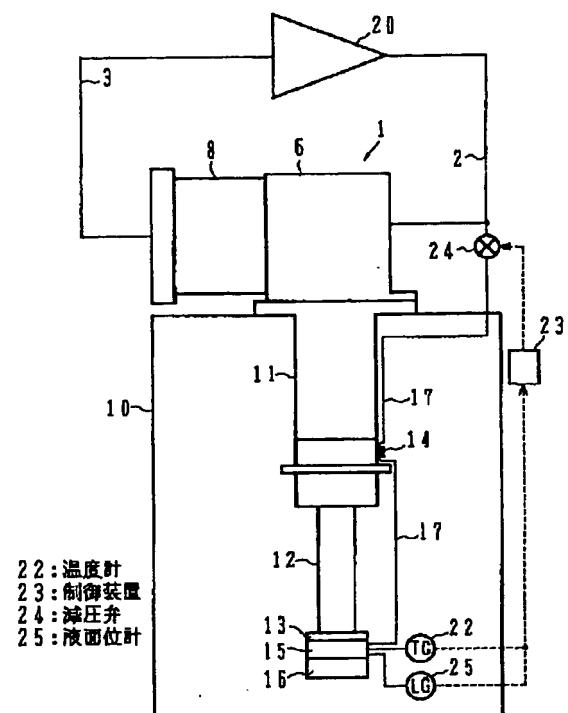
【図8】

比熱の温度変化



【図7】

本発明の第4の実施例



【手続補正書】

【提出日】平成5年12月10日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0038

【補正方法】変更

【補正内容】

【0038】Heは、2.26気圧以上になると、超臨

界になり温度を下げても液化しなくなる。バルブ24を調整してHeボット15内の圧力が2.26気圧以下になるように制御することにより、Heボット15内のHeを液化させることができる。Heボット15内のHeの一部が液化すれば、熱量の変化は潜熱として使用され温度変化として現れないため、さらに温度の安定性を高めることができる。